

日本の精緻を、成膜技術に。

**SHINCRON**

**CORPORATE PROFILE**

# シンクロンが刻んできた、 薄膜形成の技術革新史。

シンクロンは、真空薄膜形成装置の開発から販売までを一貫して手がける世界のリーディングブランドです。

私たちの製品開発の歩みは、薄膜形成技術の歴史そのものです。

時代のニーズに応え続けた、シンクロンの70年史

シンクロンの歩み

**1951年** 株式会社シンクロンの前身である  
有限会社真空器械研究所設立。

LC シリーズ

**1951年**~ ベルジャータイプの  
単層成膜装置  
成膜装置の草分け。



BMC シリーズ

**1971年**~ 世界初、円筒二つ割り構造の  
チャンバー採用。



イオン銃KIS

**1983年** イオン源KISシリーズ  
販売開始。  
樹脂基板への密着性  
が飛躍的に向上。



B/A制御(特許)

**1977年** 高精度な膜厚制御技術を確立し、  
光学特性の性能向上を実現。



VE シリーズ

**1962年**~ カラー放送の実現に向け、  
テレビカメラのレンズに  
マルチコートが必須となる。  
EBを搭載することにより、これを実現。

**1964年** 東京オリンピックのカラー放送に寄与。

BSC シリーズ

**1984年**~ 液晶用低抵抗ITO膜を実現。

CES シリーズ

**1978年** 成膜室を都度大気開放  
せずに連続的な蒸着を可  
能にした。



カメラ



テレビカメラ



眼鏡



CD/液晶

1950

1960

1970

1980

1950~  
神武景気  
(高度経済成長期の始まり)

1960~  
カラーテレビ本放送が開始さ  
れる。高度経済成長期の中、  
東京オリンピック開催。

1970~  
眼鏡の反射防止膜の普及。  
やがてレンズはガラスから樹脂に。

1980~  
液晶、CDの普及が始まる。

薄膜形成における  
世界的リーダーとして、  
業界の進化を支えてきました。

設立は、後に日本の高度経済成長期が始まるかという1951年のこと。  
私たちは、新たなニーズが生まれるたびに、  
培ってきた経験と技術をもとに革新的な製品を市場投入し、  
薄膜形成の進化に貢献してきました。  
研究、開発、設計、製造、導入、サポートまでの一貫体制を整えることで、  
これからも薄膜形成装置のトータルサービスを提供し、日本はもちろん、  
世界中のものづくりを支え続けていきます。



SHINCRON



**1991年** 「真空器械工業」から「シンクロン」  
に社名変更。

ACE シリーズ  
**1992年**~ 多層膜フィルタの用途が拡大、  
IADの時代へ。



RAS シリーズ  
**2002年**~



スパッタリングによる高速で安定的な光学膜の成膜が可能に。  
デジタル家電向け光学部品に幅広く対応。

SLS シリーズ  
**2014年**~ RAS技術を応用し、高周波デバイスの高性能化に対応。

PMC/CSS シリーズ  
**1994年**~ 高周波デバイス用ロードロック式成膜装置。  
携帯電話の小型化に寄与。

ACE-AFS シリーズ  
**2009年**~ ACEシリーズを機能膜に展開。  
耐久性の高い防汚膜をタッチパネル上に実現。  
操作性、視認性の向上につながった。

MIC シリーズ  
**2010年**~ 上海工場にて、グローバルスタンダード機として、  
本格的な生産を開始。



携帯電話



デジカメ / DVD / 薄型テレビ



スマートフォン / タブレット端末



5G / IoT

1990

2000

2010

2020

1993~  
デジタル通信の開始(第2世代)。

2003~  
デジタル家電の隆盛。  
(デジタルカメラ・DVD・薄型TV他)

2010~  
タブレット端末の登場。  
先進運転支援システムの普及。

2020~  
5G、IoTに対応する機器の普及、インフラ整備が進む。

1999~  
ITバブルの到来。

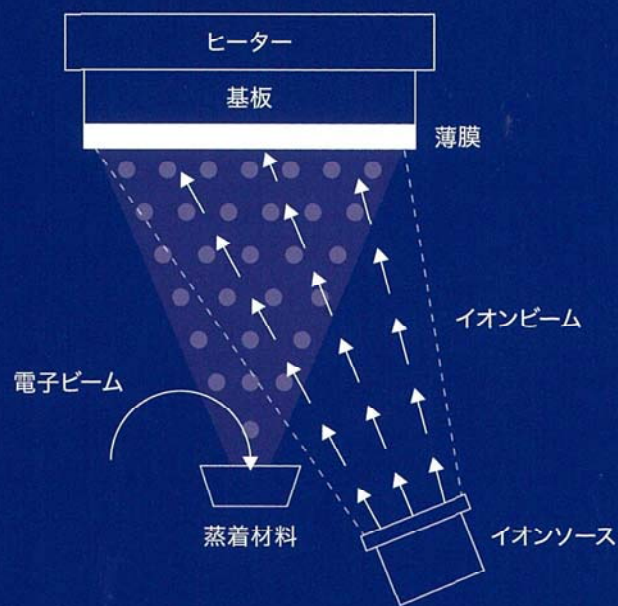
2007~  
iPhoneの登場。



薄膜形成の未来を拓き続けてきた  
シンクロンのプロセス技術。

# IAD Ion-beam Assisted Deposition

イオンビーム・アシステッド・デポジション



真空蒸着法は、蒸発現象を利用して成膜を行う方法です。1蒸着分子の持つエネルギーは0.1-0.4eV程度と低く、密着力、膜質で問題を起こすことがありました。

IAD法は、蒸着により基板に形成される薄膜にイオンを照射することで、エネルギーを与える手法として開発されました。IAD法により、密着力と膜質が改善され、耐候性に優れ密度の高い誘電体薄膜を形成することが可能になりました。

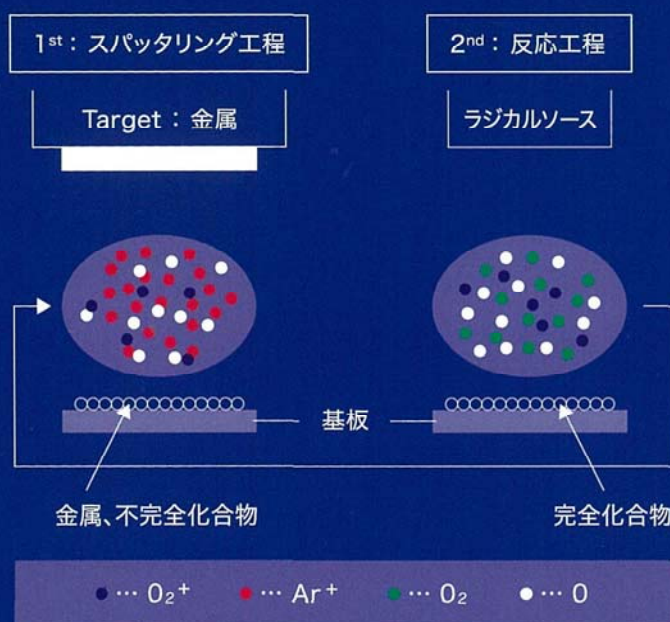
私たちは世界で初めてIAD法を用いた量産用真空蒸着装置を開発、販売し、今日まで多くのお客様にお使いいただいています。



シンクロンは、高い技術力により、蒸着とスパッタの両方式の進化に貢献してきました。  
これからもお客様のニーズに最適な製品を開発し、薄膜形成の次の未来を拓いていきます。

# RAS Radical Assisted Sputtering

ラジカル・アシステッド・スパッタリング



従来のスパッタリングは以下の問題があり、誘電体薄膜の大量生産には向かないとされていました。

- ① 異常放電によるTarget、基板へのダメージ
- ② アノードの消失に起因するプロセスの不安定さ
- ③ 成膜速度

RASはスパッタリング工程と反応工程とを分離することにより、これらの問題を解決しました。このことは反応性スパッタリングによる誘電体薄膜形成に革命的な進歩をもたらしたといえます。

スパッタリングによる誘電体薄膜の大量生産が可能になったことにより、スマートフォンをはじめ、IoTを支えるさまざまな製品の生産に活用されています。

# 高品位な光学薄膜を実現する、 スタンダードラインナップ。

## MIC 汎用 蒸着装置

### 幅広い成膜ニーズに対応

光学膜から金属膜まで、成膜に関する幅広い要求に対応できる、汎用性の高い蒸着装置です。高水準の性能や量産性はそのままに、新機種ではコストパフォーマンスのさらなる向上を実現しています。球状ドーム、分割ドーム、反転パレット仕様等、様々な基板用途に対応する豊富なオプションをご用意しており、お客様の生産目的に合わせてお選びいただけます。



MIC-1350

### 特長

- 大口径高出カイオン源を採用し、アシスト成膜が可能です。
- 正確な制御を実現する光学膜厚計、多点モニタ交換機構を採用しています。
- ターボ分子ポンプにより、オイルフリーでクリーンな環境下で成膜できます。
- 排気、プロセス中に発生するパーティクル対策が施されています。
- 稼働管理システムを搭載、リアルタイムでの状況把握やロス解析等にご利用頂けます。
- in-situモニタを採用、歩留まり向上や調整期間の短縮が可能です。

### 主な用途 / 市場

- 光学膜の形成
- 金属膜の形成
- その他、幅広い用途に対応

### 仕様概要

型 式 :	MIC-900	MIC-1350	MIC-1650	MIC-1900
基板ドーム :	Φ800mm	Φ1200mm	Φ1500mm	Φ1700mm
膜 厚 計 :	光学式膜厚計・水晶式膜厚計(6点ロータリーセンサ)			
蒸 発 源 :	EB×2			
ア シ ス ト :	RFイオン源			
排気システム :	あらびきユニット・ターボ分子ポンプ・マイスナトラップ			
オ プ シ ョ ン :	反転機構・遊星回転機構・自公転機構			



# VISION 眼鏡用蒸着装置

眼鏡レンズの反射防止膜に  
特化した専用機

## 特長

- レンズ全面に均一な膜を成膜することができます。
- 無駄を省いた設計が施され、メンテナンス性に優れています。



## 仕様概要

型 式 :	VISION-900	VISION-1350	VISION-1650
基板ドーム :	Φ800mm	Φ1200mm	Φ1500mm
膜 厚 計 :	水晶式膜厚計		
蒸 発 源 :	EB×1		
ア シ ス ト :	RFイオン源		
排気システム :	あらびきユニット・ターボ分子ポンプ・マイスナトラップ		

# ARC プラスチック用蒸着装置

デジカメやスマホカメラ等の  
樹脂レンズ成膜に最適な装置

## 特長

- 分割ドームを用いて、一度に大量のレンズを成膜することができます。
- 低温成膜に最適な基板加熱方式を採用するとともに、プラスチックから放出される水分の影響を抑える配慮がなされています。



## 仕様概要

型 式 :	ARC-900	ARC-1350	ARC-1650	ARC-1900
基板ドーム :	Φ800mm	Φ1200mm	Φ1500mm	Φ1700mm
膜 厚 計 :	光学式膜厚計・水晶式膜厚計(6点ロータリーセンサ)			
蒸 発 源 :	EB×1			
ア シ ス ト :	RFイオン源			
排気システム :	あらびきユニット・ターボ分子ポンプ・マイスナトラップ			
オプション :	反転機構・遊星回転機構・自公転機構			

# 豊富なバリエーションを誇る、 連続式蒸着装置。

## CES 連続式 蒸着装置

### 安定性・量産性に優れたロングセラー機

蒸着室を成膜のたびに大気にさらすことなく、常に高真空中に保つことが可能。そのため、屈折率が安定し、高品位な光学薄膜を極めて高い再現性をもって生産することができます。クリーンルーム対応のMタイプ、多品種対応のDタイプと、多彩なラインナップをご用意しています。



### 特長

- 蒸着室を真空状態のまま保持するため、屈折率が安定し、高品質な成膜が可能です。
- 成膜・排気・加熱・リークを別チャンバーで同時実行するため、生産性に優れています。
- さまざまな薬品に対応し、給材機構を備え、多種多様な成膜を連続で行うことができます。
- ドーム投入→成膜→ドーム取り出しまで自動化されており、省人化対応が可能です。

### 主な用途 / 市場

- 反射防止膜
- カメラレンズ、眼鏡レンズ、スマートフォンレンズ

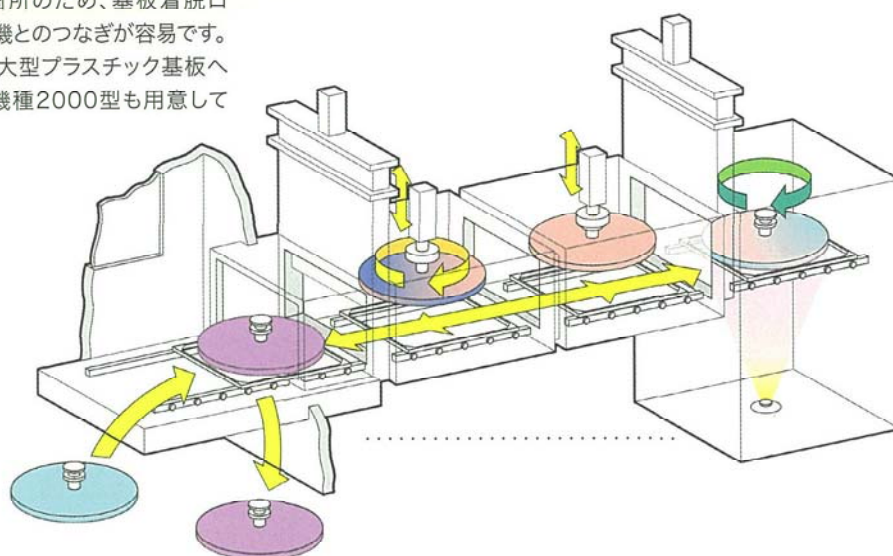
### 仕様概要

型 式 :	Mタイプ CES-3M			Sタイプ CES-3S		Dタイプ CES-3D		
	1100	1350	2000	900	1050	900	1100	1350
基板ドーム :	Φ950mm	Φ1200mm	Φ850mm	Φ718mm	Φ950mm	Φ718mm	Φ950mm	Φ1200mm
膜 厚 計 :	光学式膜厚計・水晶式膜厚計(6点ロータリーセンサ)							
蒸 発 源 :	EB×2							
ア シ ス ト :	RFイオン源							
排気システム :	あらびきユニット・拡散ポンプ・ターボ分子ポンプ							
オ プ シ ョ ン :	クライオポンプ・撥水膜成膜機構							



クリーンルームに対応するMタイプ、眼鏡レンズの反射防止膜等に多数の実績を誇るSタイプ、少量多品種のガラスレンズ成膜に適したDタイプ、様々なご要望に応えるラインナップをご用意しています。

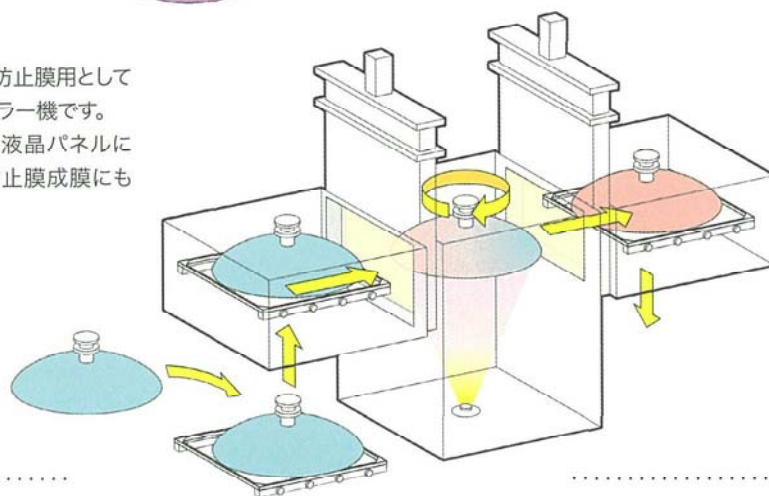
クリーンルーム対応を目的に製作されました。基板出入り部分が1箇所のため、基板着脱口ポットや洗浄等前処理機とのつながりが容易です。630mm×800mmの大型プラスチック基板への成膜に有効な大型機種2000型も用意しています。



TYPE

M

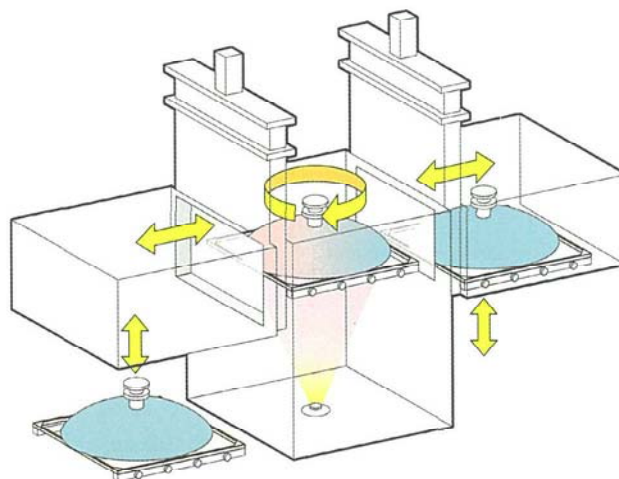
プラスチック眼鏡レンズの反射防止膜用として高い信頼と実績を誇るベストセラー機です。携帯端末等、情報機器関連の液晶パネルに使用される光学部品の反射防止膜成膜にも使用されます。



TYPE

S

基板加熱条件を“両サイド入れ替え室”別々に設定できるため、少量多品種の成膜に適しています。多品種のガラスレンズへの加熱蒸着に使用されています。



TYPE

D

# 時間制御のみで高品質な 光学薄膜を再現性良く成膜。

## RAS ロードロック式 スパッタ装置

独自開発のRAS方式により、  
優れた生産性・安定性を発揮

シンクロンが独自に開発したRAS (Radical Assisted Sputtering) 方式により、波長シフトのない高密度な光学薄膜、装飾膜を含む機能性薄膜、窒化膜などを高い再現性をもって成膜できます。また、低温成膜のため、多様なアプリケーションに対応することが可能です。



RAS-1100C

### 特長

- 波長シフトのない高密度な光学薄膜の形成が可能です。
- 低温成膜のため、多様なアプリケーションに対応。
- 高精度の膜組成、膜厚の制御が可能、蒸着ではできない機能膜を実現します。
- 高屈折率材料と低屈折率材料による混合膜により、再現性の高い中間屈折率膜が可能に。
- メンテナンス、掃除の負担を軽減する工夫がなされています。
- 排気、プロセス中に発生するパーティクル対策が施されています。
- 稼働管理システムを搭載、リアルタイムでの状況把握やロス解析等にご利用頂けます。

### 主な用途 / 市場

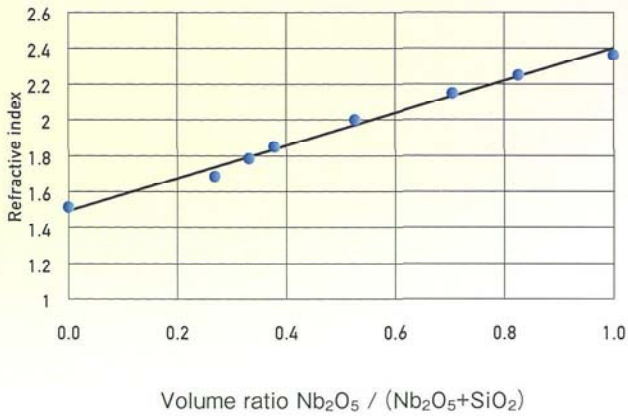
- 光学膜の形成
- 金属膜の形成
- その他、幅広い用途に対応

### 仕様概要

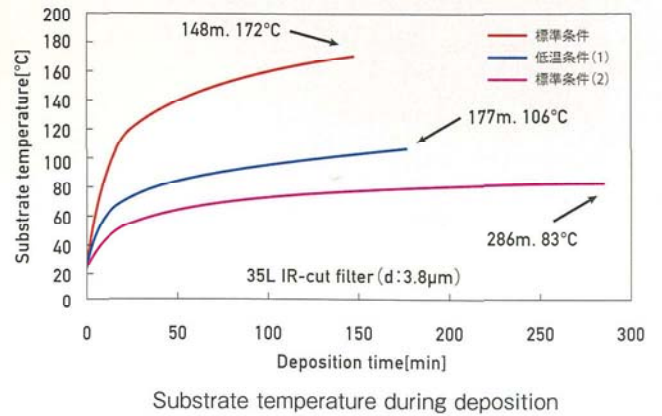
型 式 :	RAS-1100C	RAS-1100BII	RAS-1600plus
基板ドラムサイズ :	φ1100mm×230mm	φ900mm×400mm	φ1400mm×910mm
ラジカル源 :	ICP RF電源		ICP RF電源×2基
スパッタ源 :	Dual cathode・18"×5" Planer cathode	Dual cathode・27"×5" Planer cathode	Dual cathode・47"×5" Planer cathode
排気システム :	【CH-1】あらびきユニット 【CH-2】14インチTMP×2 マイスナトラップ あらびきユニット		【CH-1】あらびきユニット 【CH-2】14インチTMP×4 マイスナトラップ あらびきユニット
オプション :	OPM-Z1・Dual cathode・Rotary cathode・CH-1ターゲット・CH-1 AFS機構・CH-1 高真空排気系・遊星回転基板ドラム		



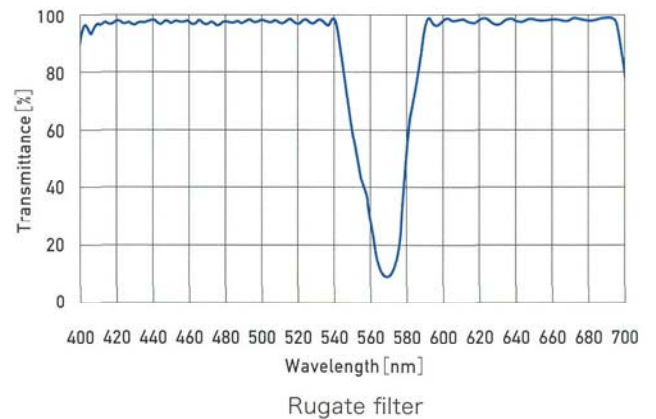
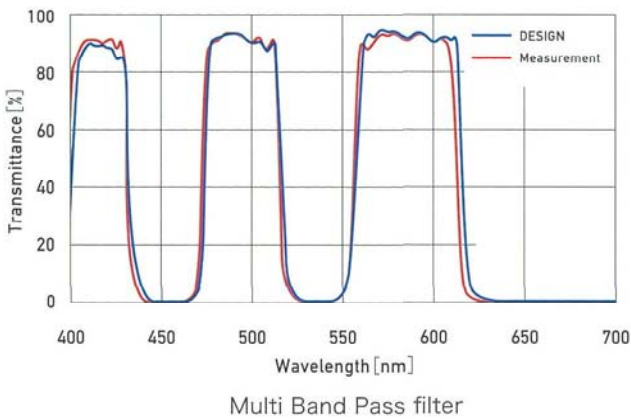
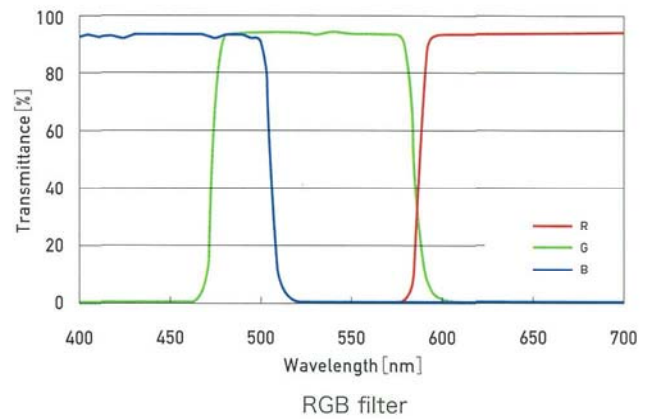
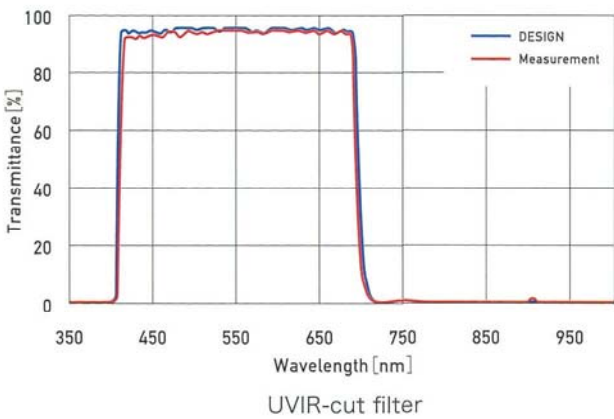
## 混合膜による自在な屈折率の実現



## 素材に応じた温度プロセスの活用



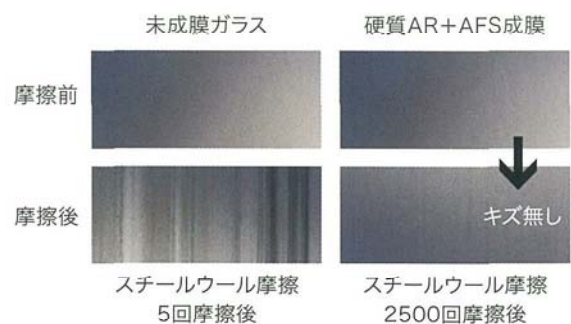
## 高精度な制御が実現



## 異形状基板への対応や硬質膜の活用



異形状基板への対応



スチールウール摩擦試験後の硬質AR+AFS膜顕微鏡写真 (×50)

# 光学薄膜で培ったノウハウを電子デバ

## PMC 金属膜用 ロードロック式蒸着装置



SAWフィルタ等の電極用金属膜の膜質と  
安定性を飛躍的に高めたロードロック式の蒸着装置です。  
AlやAl-Cu合金薄膜の品質向上と量産性に大きな効果を発揮します。

### 特長

- 配向性の高い金属膜を形成可能
- パルクに近い光学特性と電気性能の金属薄膜を形成
- リフトオフに適した金属膜形成を実現
- 平坦でヒロックレスな膜を形成可能

### 主な用途／市場

SAWFilter/LED/PA/タイミングデバイス 他

### 仕様概要

型 式 :	PMC-800-2S	PMC-800-2M	PMC-800-2MS
基板ドーム :	Φ650mm		
膜 厚 計 :	水晶式膜厚計		
蒸 発 源 :	EB×1		
ア シ ス ト :	-		
排気システム :	ドライポンプ・クライオポンプ・ターボ分子ポンプ		
オプション :	ボンバード・SEMI/GEM準拠インターフェース		

### PMC用 自動ウエハ移載ロボット

オプションにてウエハの自動脱着が可能になるロボットの採用が可能です。  
4カセットをセットでき、成膜完了後に排出されたトレイから自動でウエハを  
ULD/LDが可能です。省人、省塵、ウエハ破損率の低減など合理化が可能です。





イスに展開し、高い品質と生産性を実現しました。

# SLS

## ロードロック式 スパッタ装置

独自開発のRAS方式を採用し電子部品市場向けにさらに高機能化。  
パッシベーション膜だけでなく高密度膜やボイドフリー膜、  
メタル膜まで幅広く利用可能です。



### 特長

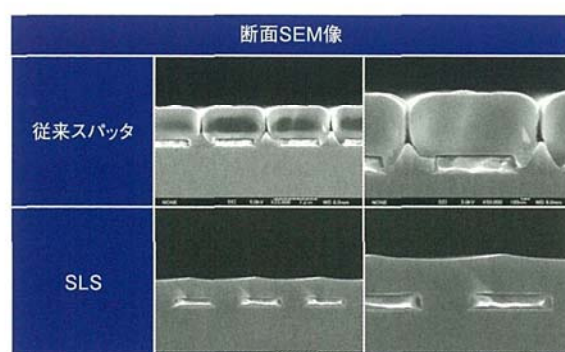
- 緻密な膜質の形成可能
- ボイドフリー成膜
- 酸化膜、窒化膜、混合膜、メタル膜など多様な薄膜形成が可能

### 主な用途／市場

SAWFilter/LED/PA/タイミングデバイス 他

### 仕様概要

型 式 :	SLS-18	SLS-27
基板ドラムサイズ :	Φ1100mm×230mm	Φ900mm×400mm
ラジカル源 :	ICP RF電源	
スパッタ源 :	Dual cathode・18"×5" Planer cathode	Dual cathode・27"×5" Planer cathode
排気システム :	【CH-1】あらびきユニット 【CH-2】14インチTMP×2 マイスナトラップ あらびきユニット	【CH-1】あらびきユニット 【CH-2】14インチTMP×4 マイスナトラップ あらびきユニット
オプション :	OPM-Z1・Rotary cathode・CH-1ターゲット・Bias機構・SEMI/GEM準拠インターフェース	



協力: 千葉大学 橋本研究室

## SIC 金属膜蒸着装置

各種接続端子、電極等の金属薄膜を形成するバッチ式蒸着装置です。  
金属薄膜を安定的に量産することができます。

### 主な用途／市場

SAWFilter/LED/PA/タイミングデバイス 他



### 仕様概要

型 式 :	SIC-900	SIC-1350	SIC-1650
基板ドーム :	Φ800mm	Φ1200mm	Φ1500mm
膜 厚 計 :	水晶式膜厚計(ロータリーセンサ)		
蒸 発 源 :	EB×1		
基板クリーニング :	RFイオン源		
排気システム :	ドライポンプ・クライオポンプ		
オプション :	SEMI/GEM準拠インターフェース		

## CSS 誘電体薄膜用スパッタ装置

長年培われた当社技術により安定的に誘電体膜を形成することができます。  
SiO<sub>2</sub>、SiN等の保護膜用途にて幅広く利用可能です。

### 主な用途／市場

SAWFilter/BAWFilter/LED/Laser/PCB 他



### 仕様概要

型 式 :	CSS-2		
基板ドーム :	Φ650mm		
スパッタソース :	マグネトロンスパッタソース(Φ10インチ)×3		
スパッタ電源 :	RF電源×3		
排気システム :	前室:あらびきポンプ	成膜室:ターボ分子ポンプ1基 + スーパートラップ	



# BSC カルーセル型 スパッタ装置

様々なニーズに対応する量産型スパッタ装置

## 特長

- 量産型スパッタ
- SiO<sub>2</sub>、ITO等を多層形成する、高度なスパッタ技術と高い量産性を兼ね備えた全自動スパッタ装置です。



## 仕様概要

型 式 :	BSC-700	BSC-1000	BSC-1900
ドラムサイズ :	Φ630mm×H330mm	Φ900mm×H760mm	Φ1700mm×H1420mm
スパッタ源 :	5"×27"×1	5"×42"×2	5"×65"×4
排気システム :	あらびきユニット・クライオポンプ/あらびきユニット・ターボ分子ポンプ		

# BMS バッチ式小型 スパッタ装置

研究開発や小規模生産に

## 特長

- 金属薄膜や誘電体薄膜など幅広い用途にお使いいただけます。
- コンパクトに設置できるため、研究開発用途にも適しています。



## 仕様概要

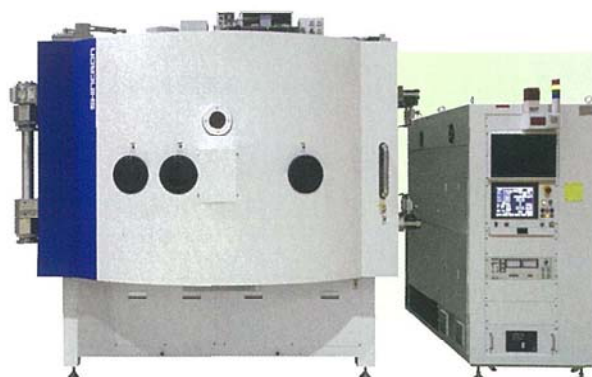
型 式 :	BMS-650	BMS-800
基板ドーム :	平板及びドーム型公転治具	
スパッタ源 :	丸型ターゲット	
クリーニング :	イオンビームクリーニング	
排気システム :	あらびきユニット・クライオポンプ	

# ACE 防汚膜用蒸着装置

タッチパネルの指紋付着防止等、防汚膜の成膜に活用されています。

## 特長

- 耐スクラッチ性に優れたAFS膜の成膜が可能です。



## コンポーネントのご紹介

### OPM

高精度な光学薄膜を制御する  
光学式膜厚計です。

#### 特長

- 色収差の少ないファイバ光学系を採用
- 光量信号のデジタル信号処理を採用
- 測定波長の設定精度0.1nmを実現



#### 仕様概要

型 式 :	OPM-Z1-VIS	OPM-Z1-UV	OPM-Z1-NIR	OPM-D1-VIS	OPM-D1-NIR
対 応 波 長 :	可視	紫外	近赤外	可視	近赤外
波長駆動範囲 :	350nm-1100nm	200nm-800nm	700nm-2400nm	350nm-1100nm	700nm-2400nm
モニタ方式 :	間接(モニタガラス)			直接(ドーム上の実基板)	

### RFイオン源

屈折率を安定させ、屈折率分布を均一化させることができます。  
耐環境特性に優れた薄膜を作成可能です。

#### 仕様概要

型 式 :	NIS-120	NIS-175	NIS-240
イオンビーム直径 :	120mm	175mm	240mm
加 速 電 圧 :	100~1000eV		
加 速 電 流 :	550mA	1200mA	2000mA
ニュートライザ電流 :	最大1000mA	最大2000mA	最大3000mA



#### 薄膜計算ソフト

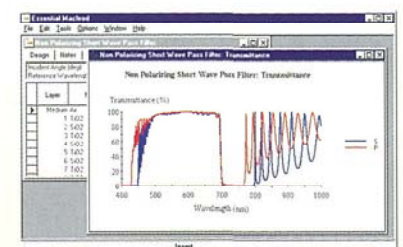
### マクロード

「Thin-Film Optical Filters(光学薄膜)」  
の著者 Dr. Angus Macleod 氏が開発した  
光学薄膜計算のためのプログラムソフトウェアです。

 **The Essential Macleod for windows**  
Thin Film Design and Analysis Package

#### 主な機能

- ① 設計した薄膜の性能評価シミュレーション
  - 分光透過率・反射率
  - 透過光・反射光の位相変化
  - 膜厚のランダムエラーによるデザインの影響計算
- ② 設計した薄膜の改良&合成
  - 要求される性能をターゲットとした透過率・反射率、位相変化等の自動最適化
- ③ 薄膜材料のデータ管理
  - 主な材料の光学定数(n,k)の提供
  - 実測した分光特性から光学定数を計算
  - 複数のデータベースによる材料管理





# 薄膜形成の未来を拓き続けてきた シンクロンのプロセス技術。

真空薄膜分野も日々革新を続けており、お客様からは新しいニーズをいただいております。シンクロンは、今までの技術の蓄積、豊富な実績を活かし、どのようなご要望にもお応えできる企業であり続けることをお約束いたします。



## SATISFACTION

お客様のご要望に技術力で対応

装置のカスタマイズ、成膜プロセスの共同開発など、装置に関するお客様のさまざまなご要望に対し、培ってきた技術力で対応いたします。



## CHALLENGE

新技術へのチャレンジを忘れない先駆者として

時代の変化を常にキャッチアップし、お客様の新たなニーズに対して即応できる体制を整えています。新しい技術、未知の領域にも積極的に挑戦し、これからもトップランナーであり続けます。



## SUPPORT

装置性能をフルに引き出す充実のサポート

装置のパフォーマンスを最大限に引き出いただくために、多面的なサポート、アドバイスをいたします。初めて装置をお使いになるお客様に向けて、各種セミナーもご用意しております。



# 先駆者として磨き続けてきた技術を さらに高めて、次世代へ。

## ご挨拶

MESSAGE



代表取締役社長 成田 正哉

1951年の創業以来、弊社が守り続けてきたポリシーがあります。それは、お客様のニーズをより深く理解するために、信頼される強固なパートナーシップを築くということです。

弊社は、真空を用いた薄膜形成技術により、光学、ディスプレイ、電子部品など様々な分野で、お客様と共に「未知の技術をつくりたい」という意気を持って、ものづくりと向き合ってきました。今もなお、お客様のパートナーとなり、ひとつのチームとなって新技術の開発や課題解決をはかり、製造装置を納入させていただいております。納入後も長い間継続してお使いいただけるよう、メンテナンスや改善改良のご提案など、きめ細かなサービスサポートの対応をさせていただいており、こうしたお客様との固いパートナーシップは、今後も変わらず大切にしておく所存です。

弊社の事業の本質は「薄膜が実現する機能によって、お客様の製品の価値を向上させる」ことです。それには、環境やコストなど市場の変化への鋭敏さ、お客様のニーズにお応えできる技術力が必要です。今後も基礎研究、応用製品開発、キーコンポーネント開発に励み、真空薄膜形成の課題解決の提案に努め、新たな技術開発への挑戦を続けながら、より多くのお客様に満足いただける、信頼されるパートナーとなることを目指してまいります。

## 会社概要

PROFILE

社 名：株式会社シンクロン

設 立：1951(昭和26)年5月

資 本 金：72.5百万円

代 表 者：代表取締役社長 成田正哉

従業員数：561名(2020年3月末グループ合計)

関連会社：上海新柯隆真空設備製造有限公司／新柯隆真空設備(上海)有限公司／新柯隆真空設備貿易(深圳)有限公司  
台湾真空龍國際科技股份有限公司／SHINCRO (MALAYSIA) SDN.BHD.  
SHINCRO TECHNOLOGY (THAILAND), LTD / SHINCRO AMERICA INC.

取引銀行：三菱UFJ銀行／三井住友銀行／みずほ銀行／山形銀行／横浜銀行



## 拠点情報

SITE INFO

JAPAN  
SHANGHAI  
TAIWAN  
SHENZHEN  
BANGKOK  
MALAYSIA

SHINCRON

本社・R&Dセンター	〒220-8680 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-3-5 TEL.045-650-2400(代)
鶴岡工場	〒997-0011 山形県鶴岡市宝田1-19-71 TEL.0235-22-4196
上海新柯隆真空設備製造有限公司 新柯隆真空設備(上海)有限公司	上海市嘉定区華亭鎮華博路666号5幢C.D区 TEL.+86-21-60406911 FAX.+86-21-60406912
新柯隆真空設備貿易(深圳)有限公司	広東省深圳市福田区濱河路与香蜜湖路交匯处天安創新科技広場二期東座1905 TEL.+86-755-8348-4121 FAX.+86-755-8348-4124
台湾真空龍國際科技股份有限公司	台中市403西区公益路161號13樓之7 TEL.+886-4-2302-0186 FAX.+886-4-2301-1434
シンクロンマレーシア	B-517, Block B, Kelana Square No.17 Jalan SS7/26, Kelana Jaya, 47301 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia. TEL.+60-3-7880-4031 FAX.+60-3-7880-3259
シンクロンタイ	121/72, RS Tower, 23rd Floor, Ratchadapisek Road, Kwang Dindaeng, Khet Dindaeng, Bangkok 10400 TEL.+66-2-642-2440 FAX.+66-2-641-2441
シンクロンアメリカ	121 E.Brokaw Rd. San Jose, CA 95112 TEL.+1-408-564-6103 FAX.+1-408-564-6160



株式会社 シンクロン

〒220-8680 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-3-5  
<https://www.shincron.co.jp/>